

Title (en)
Electroplating apparatus.

Title (de)
Galvanisiereinrichtung.

Title (fr)
Dispositif de galvanisation.

Publication
EP 0070011 A1 19830119 (DE)

Application
EP 82106169 A 19820709

Priority
DE 3127390 A 19810710

Abstract (en)
[origin: US4427518A] A device for continuously processing an article such as by electroplating including a tank equipped with a horizontally disposed rotating electroplating drum, an entry station disposed for introducing an article to one end of the drum and an exit station for removing the processed article from the drum. The electroplating tank as well as the entrance and exit stations are provided with gas-tight seals so that the device may be utilized for an oxygen-free and water-free aluminum-organic electrolyte for the electrodeposition of aluminum. Preferably, the entrance and exit stations contain liquid locks to prevent the controlled atmosphere above the electrolyte from being contaminated.

Abstract (de)
Einrichtung zum Galvanisieren im Durchlauf, wobei die Galvanisierwanne (1) mit einer horizontal angeordneten, drehbaren Galvanisiertrommel (4) ausgestattet ist; an einem Ende der Trommel (4) ist eine Eingangsstation (2) und am anderen Ende eine Ausgangsstation (3) angeordnet. Insbesondere bei Verwendung eines sauerstoff- und wasserfreien aluminiumorganischen Elektrolyten zum galvanischen Abscheiden von Aluminium sind die Galvanisierwanne (1) sowie die Eingangs- und Ausgangsstation gasdicht abgeschlossen. Vorzugsweise enthalten die Eingangs- und Ausgangsstation (2 bzw. 3) je eine Flüssigkeitsschleuse.

IPC 1-7
C25D 17/20

IPC 8 full level
C25D 17/20 (2006.01); **C25D 17/26** (2006.01); **C25D 17/28** (2006.01)

CPC (source: EP US)
C25D 17/20 (2013.01 - EP US)

Citation (search report)

- DE 2353592 B2 19750605
- DE 2538674 B2 19770623
- DE 2524315 A1 19751211 - MONROE BELGIUM NV
- DE 2728366 A1 19771229 - TRW INC
- US 4105526 A 19780808 - LEWELLEN JR WENDELL G, et al

Cited by
US4670120A; US4668367A; US4803811A; US4701248A; DE10011865C1; US4876801A

Designated contracting state (EPC)
AT BE CH DE FR GB IT LI NL SE

DOCDB simple family (publication)
EP 0070011 A1 19830119; EP 0070011 B1 19850123; AT E11433 T1 19850215; CA 1184531 A 19850326; CS 236675 B2 19850515; DD 202462 A5 19830914; DE 3127390 A1 19830210; DE 3262046 D1 19850307; DK 157622 B 19900129; DK 157622 C 19900618; DK 309482 A 19830111; FI 70602 B 19860606; FI 70602 C 19860924; FI 822457 A0 19820709; FI 822457 L 19830111; HU 183995 B 19840628; JP H0249400 B2 19901030; JP S5819495 A 19830204; NO 158756 B 19880718; NO 158756 C 19881026; NO 821788 L 19830111; SU 1192629 A3 19851115; US 4427518 A 19840124

DOCDB simple family (application)
EP 82106169 A 19820709; AT 82106169 T 19820709; CA 407019 A 19820709; CS 528182 A 19820709; DD 24131682 A 19820701; DE 3127390 A 19810710; DE 3262046 T 19820709; DK 309482 A 19820709; FI 822457 A 19820709; HU 224482 A 19820709; JP 11912882 A 19820708; NO 821788 A 19820528; SU 3460494 A 19820709; US 38397982 A 19820601